

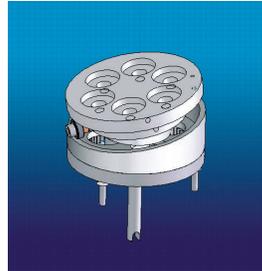
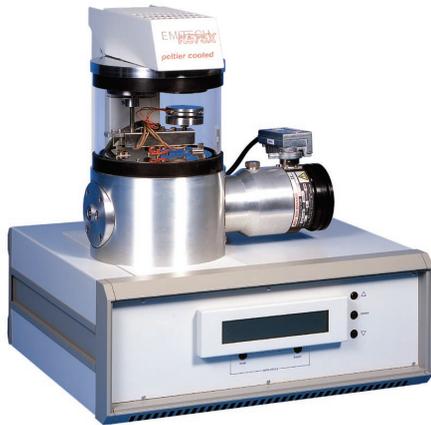
K575X
K575XD

デジタル

高性能ターボスパッタコーター

チェンバーサイズ 165mm 径 Cr 対応機

EMITECH
sample preparation



EK4197 (オプション) オシレーション / 回転試料ステージ

K575X シリーズは 60L/sec のターボ分子ポンプを採用し、オプションのロータリーポンプと組み合わせてスピーディーな真空引きを行います。複雑な操作などは無く、優れた自動制御によりどなたにも簡単にスパッタコーティングが行えます。

使用するターゲットには Au や Pt 等はもちろん、コーティング前の脱ガス処理が自動で行われるため、従来のスパッタコーターでは難しいクロム等を含む酸化しやすい金属も容易にコーティングすることができます。

DC マグネトロンヘッドを採用し、ターゲットの交換は容易に行えます。

ターゲット部には優れたペルチェ冷却機構 (冷却水は不要) が備わっており、安定した高精細のコーティングが可能です。

スパッタ条件は事前に設定することができ、アルゴンガス流量はニードルバルブを利用して最適な値に調整することができます。

チェンバー径は 165mm で、オプションで 100mm 径までの試料ステージを用意しています。試料導入後、真空引き、コーティング、大気開放までの平均的な処理時間は約 5 分間です。

ターボ分子ポンプのバックリング用真空ポンプ

オイルミストフィルター付 50L/min ロータリーポンプ (オプション)。

主な機能とメリット

- ターボ分子ポンプを採用したクリーンな環境Crなど酸化しやすい金属で微細のコーティングが行えます。
- 全自動システム: キー入力により簡単に操作が行えます。
- 簡単な操作: 液晶表示部に表示されたメニューに沿って条件を入力するのみ。
- ペルチェ冷却式スパッタヘッド: 冷却水が不要。
- 微細コーティング: Cr ターゲットでは粒径 0.5nm サイズ。
- 試料回転ステージを標準採用。
- 幅広い選択のオプションターゲット。

製品仕様

付属品	Cr ターゲット、真空ホース 1m、ホース用フィッティング、防護シールド、アクセサリパック
電源	100V、15A (ポンプ含む) 50/60Hz
試料ステージ	60mm 径、回転機構付き オプションで 100mm 径のステージを用意
ターゲット	57mm 径
オプションターゲット	Cr、Ir、C、ITO、Al、他
本体寸法	幅 450mm / 奥行き 350mm / 高さ 175mm
チェンバー寸法	幅 165mm / 高さ 125mm
本体重量	42Kg
真空ポンプ	ターボ分子ポンプ 60L/sec タイプ搭載 (別途、バックリング用ポンプが必要) ロータリーポンプとオイルミストフィルターの組み合わせ (オプション)
操作時の真空圧力	1×10^{-2} mbar から 1×10^{-4} mbar
スパッタ時間	1サイクル 0 から 4 分間の選択可能

オプション

K250 カーボンコーティング・アタッチメント

シングルカーボンファイバーもしくはシングルカーボンロッドの選択可能。50mm サイズまでカーボンコーティングが行えます。

- K150X 膜厚計 (FTM)
- EK4181 高真空ベニングゲージヘッド
- EK4197 オシレーション / 回転試料ステージ

EK4225 真空保持アタッチメント

装置シャットダウン後もチェンバー内を高真空下に保つことが可能です。

SEM ベーシックスターターキット

- 試料スタブ取付台、収納ケース、マウントメディア、ピンセット

K575XD

デュアルヘッドシステム (姉妹品)

異なる2つのターゲットを取り付けができ、真空を破ることなく個別に2つのターゲットを交互にコーティングすることが可能です (Cr、Au が標準)。